BAM
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Referenzverfahren

Bestimmung der Schichtdicke von Siliziumoxid-Filmen auf Silizium mit Elektronenspektroskopie (XPS/ESCA)

Kompetenznachweis

ISO/IEC 17025 Akkreditierung

Prüfgrößen und -objekte

Wafer
Objektgröße ca. (10 × 10) mm^2

Prüfbereich

Siliziumoxid-Filmdicke bis 3 nm

Erweiterte Messunsicherheit (k = 2)

Relativ $U(n)$ = 2 %

Anwendungsbereich

Halbleiterindustrie

Referenzen

ISO 14701:2018, Surface chemical analysis - X-ray photoelectron spectroscopy - Measurement of silicon oxide thickness, https://www.iso.org/standard/74818.html.

Ansprechperson

Dr. Jörg Radnik
Joerg.Radnik@bam.de
030 8104-4548